

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成 19 年 1 月 11 日 (2007.1.11)

【公開番号】特開 2003-27246 (P2003-27246A)

【公開日】平成 15 年 1 月 29 日 (2003.1.29)

【出願番号】特願 2001-218311 (P2001-218311)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/509 (2006.01)

G 0 3 G 5/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/509

G 0 3 G 5/08 3 1 2

G 0 3 G 5/08 3 6 0

H 0 1 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 11 月 20 日 (2006.11.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】 減圧可能な反応容器内に導入したガスを前記反応容器内に設けられた電極に供給した高周波電力により分解してプラズマを生成して、被処理物の処理をするプラズマ処理方法において、

複数の異なる周波数の前記高周波電力を同一の前記電極に供給する工程と、

前記各高周波電力のうち、少なくとも 1 つの前記高周波電力の周波数を前記被処理物の処理中に变化させる周波数変化工程とを含むことを特徴とするプラズマ処理方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 7】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明のプラズマ処理方法は、減圧可能な反応容器内に導入したガスを前記反応容器内に設けられた電極に供給した高周波電力により分解してプラズマを生成して、被処理物の処理をするプラズマ処理方法において、複数の異なる周波数の前記高周波電力を同一の前記電極に供給する工程と、前記各高周波電力のうち、少なくとも 1 つの前記高周波電力の周波数を前記被処理物の処理中に变化させる周波数変化工程とを含むことを特徴とする。